## GaAs/InGaAs/GaAs コアマルチシェルナノワイヤ共振器における 発光の解析

Analysis of luminescence in GaAs/InGaAs/GaAs core multi-shell nanowire cavity 北海道大学情報科学研究院および量子集積センター

○国本 大雅、本久 順一、原 真二郎

Graduate School of IST and RCIQE, Hokkaido Univ.

<sup>O</sup>Taiga Kunimoto, Junichi Motohisa, Shinjiro Hara

E-mail: kunimoto@rciqe.hokudai.ac.jp

[はじめに] ベクトル光波は、ビームの広が りの中で偏光状態が軸対称に分布している 光である。通常の光とは異なる強度分布や 特性を持つため、光マニピュレーションや レーザー加工といった多様な分野への応用 へ向け研究が進められている。現在までに 報告されている発生方法の多くはマクロな 光学系を必要とするが、プラズモニックナ ノキャビティによるナノレーザーでは方位 偏光と径偏光のベクトル光波の発生報告 [1],[2]があり、微小光源としての利用に可能性 を示している。我々は、半導体ナノワイヤ (NW)の導波モードとベクトル光波の親和 性に注目し、NW を用いた微小ベクトル光 波源の作製について検討してきた。本研究 では、GaAs/InGaAs/GaAs コアマルチシェル (CMS)NW に対するフォトルミネッセンス (PL)測定とその評価を行い、NW 共振器から の発光特性について報告する。

[実験方法] 先行研究<sup>[3]</sup>で作製された GaAs/InGaAs/GaAs CMS NW に対し低温顕 微 PL 測定を行った。励起光源には連続波 (CW)光源として He-Ne レーザーを、パルス 光源としてモードロックした Ti:Sapphire レ ーザーを用いた。

[結果] 図 2(a)は単一の異なる NW に対しそ れぞれ CW 光(実線)と強度の強いパルス光 (点線)で励起した時の PL スペクトルである。 スペクトルやピーク位置が NW ごとに異な るのは、コアサイズや InGaAs 層の厚さにナ ノメートルオーダーでのばらつきが生じて いるためだと考えられる。また、NW(b)と(c) の CW 励起した場合のスペクトルでは、半 値幅の狭いピークを複数確認することがで き、これらが NW の共振モードを反映した ピークであることは先行研究[3]により確認 されている。そして、パルス励起では、CW 励起の場合より短波長側にもピークが現れ ている。図 2(b)に NW(c)のパルス光励起時 の発光スペクトルの強度依存性を示す。励 起光強度に対し線形に強度が増大するピー

クに加え、励起光強度に対し非線形的に増大するピークが観測されている。このうち875nm 付近のピークについて、L-L 曲線として示したのが図 2(c)のグラフである。ピーク強度は励起光強度の増大に伴って必要は励起光強度の増大に伴ってピーク強度は開かれている。新しく出現したピークと NW の共振器モードとの関係はまだがさいと、このピークによる発光像におけるとに、このピークによる発光像におけると類似した、軸対称の偏光分布とな点をかた。当日は、このおれた。当日は、このおれたがある。となれたが、

## [参考文献]

- [1] M. Khajavikhan et al.. Nature 482 (2012) 204
- [2] K. Ding et al., Appl. Phys. Lett. 102 (2013) 041110.
- [3] T.Wada et al., Extended Abstracts of SSDM 2015.

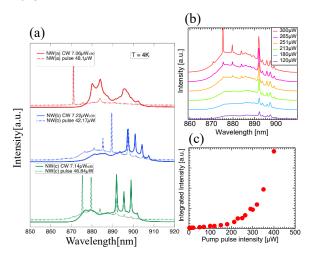


Fig1. (a) PL spectra of three individual nanowires under CW and pulsed excitation (b)The excitation intensity dependence of the PL from NW(c)

(c) L-L characteristics of the peak at 875 nm